

X光顯微鏡機構

本院覽號

02A-1001209

公告日期

智財權狀態

台灣(發明)I457598放棄維護、中國ZL
201210064915.X放棄維護、美國US 9,075,245 B2放棄
維護

摘要

本發明使用特殊設計，除了便於攜帶更大幅降低熱膨脹問題，使X光顯微鏡進行奈米級量測時有極高之剛性與熱穩定性。

技術優勢

傳統X光顯微鏡體積龐大極不便於攜帶，且其機構設計不足以符合奈米等級結構量測之需求。本發明使用特殊設計，除了便於攜帶更大幅降低熱膨脹問題，使X光顯微鏡進行奈米級量測時有極高之剛性與熱穩定性。

應用範圍

奈米級材料3D呈像 奈米級生物3D呈像

創作人

胡恩德



中央研究院
ACADEMIA SINICA